Atomic Energy Science and Technology

Vol. 36 ,No. 6 Nov. 2002

用于质子直线加速器的 强流电子回旋共振离子源

崔保群,李立强,包轶文,蒋渭生,王荣文 (中国原子能科学研究院核物理研究所,北京 102413)

摘要:研制了一台用于加速器驱动次临界系统 (ADS) 的强流电子回旋共振离子源。在 30 keV 能量下, 引出的氢离子最大束流达到 100 mA,质子比好于 85 %,引出束流密度最高可达 340 mA/cm²。初步测定 的发射度约为 0.11 mm mrad。已通过了 100 h 的连续运行考验。 关键词:电子回旋共振离子源;加速器驱动次临界系统;质子比;发射度 中图分类号:TL503.3 **文献标识码**:A **文章编号**:1000-6931(2002)06:0486:04

An Intense ECR Ion Source for Proton Linac

CUI Bao-qun, LI Li-qiang, BAO Yi-wen, JIAN G Wei-sheng, WAN G Rong-wen (China Institute of Atomic Energy, P. O. Box 275-27, Beijing 102413, China)

Abstract :An intense electron cyclotron resonance ion source for proton linac has been developed. At 30 keV, 100 mA hydrogon beam is extracted from the source, proton ratio is greater than 85 % and the beam density of 340 mA/ cm^2 is achieved, the rms emittance of the beam is around 0.11 mm mrad. The source has passed 100 h reliability test.

Key words :electron cyclotron resonance ion source ; accelerator driven sub-critical system ; proton ratio ; emittance

中国原子能科学研究院正在进行加速器驱 动次临界系统 (accelerator driven sub-critical system,ADS)方面的研究。其质子直线加速器 的一重要部件就是强流离子源。为了与 RFQ 加速段匹配,要求的质子能量为 75 keV,连续 束流强大于 50 mA,质子比高于 85 %,归一化 均方根发射度 n rms 0.2 mm ·mrad,能长时 间连续稳定运行。这些要求对离子源研究工作 是一个很大的挑战。微波激励的电子回旋共振 (ECR)离子源无灯丝阴极,寿命可大大延长。 另外,它的效率高,束流品质好,因此,国际上许 多实验室都选用这种离子源^[1~4]。本工作拟 研制用于质子直线加速器的强流 ECR 离子源。

1 实验装置

ECR 离子源是将微波功率以适当方式馈 入一放电腔,腔内有一与微波电场相垂直的恒 定磁场,当磁场强度达到电子回旋共振条件时,

收稿日期:2001-10-16;修回日期:2002-04-15

基金项目:国家自然科学重点基金资助项目(19835070);国家重点基础研究(973)计划资助项目(G1999022605) 作者简介:崔保群(1966 —),男,河南辉县人,高级工程师,离子束技术专业

腔中电子从微波获得能量并与周围气体碰撞产 生电离,形成等离子体,用高压电场从放电腔的 一引出孔将离子引出而形成离子束。

本工作中研制了两种不同结构的 ECR 离 子源,它们均用 2.45 GHz 的微波来产生放电 等离子体。

图 1 为一台紧凑型 ECR 离子源的结构示 意图。它的微波系统由磁控管、三螺钉调谐器、 反射功率监测器组成。

磁控管及波导为标准产品,三螺钉调谐器 用来调整微波的传输,减少反射。一段脊波导 用来匹配波导和放电室的阻抗。真空密封由位 于脊波导与螺钉调谐器之间的 Al₂O₃ 陶瓷窗完 成。微波功率通过脊波导馈送到一石英放电管 中。石英管由一厚 3 mm 的 BN 薄片微波窗与 脊波导相隔,管的另一端与离子源的出口板相 连、它们一起构成了放电室。一根细石英管将 气体送进放电室。ECR 离子源放电所需的共 振磁场由图中所示的电磁铁产生。两块磁铁沿 脊波导形成一磁极,软铁制成的出口板构成另 一磁极。一个水冷励磁线圈可方便地产生和调 节放电室中的磁场,使得引出的离子束流强最 大。离子束被一加速、减速电极系统引出.目 前,加速电压为 30 kV。束流由一带磁场抑制 的水冷法拉第筒测量,并已经热量法校正,排除 了二次电子的影响。引出束经过一 台 60 分析



图 1 ECR 离子源结构示意图 Fig. 1 Schematic diagram of ECR ion source 1—引出电极;2——放电室;3——励磁线圈; 4——软铁;5——脊波导;6——微波窗; 7——调谐段;8——检测段;9——磁控管

2

磁铁测定其质谱。离子束进入磁铁前有一段漂 移空间,可放置发射度测量装置。

2 实验结果

紧凑型离子源用了一直径仅为 30 mm 的 石英放电室,配以改进的脊波导,源的引出孔径 为 5 mm,获得了很好的结果。引出束流与磁 场的关系曲线示于图 2,最佳磁通密度约为 102 mT,比离子回旋共振磁场 87.5 mT 大。这是 由于在此磁场下,等离子体从更为复杂的过程 中进一步获取能量而大大提高了浓度^[5]。



图 2 磁场与束流强度的关系



引出束流与进气量的关系示于图 3。可看 出,进气量达到一定值后,对引出束流影响很 小。



测得的质子比示于图 4。在较大的微波功 率下质子比可高达 92 %以上。引出的氢离子 流最大可达 68 mA,相应的束流密度达到 340 mA/cm²。





为提高离子束流强,还研制了另一种结构 的 ECR 离子源,其结构示于图 5。它的两个励 磁线圈在真空窒之外,可分别调节其位置和电 流,使之在放电室中产生最佳的磁通密度及分 布。放电室直径为 100 mm,长 100 mm,出口 孔径为 7.3 mm。微波系统与前述一台相同。 实验显示,该源的效率很高,在进气量为 1.5 mL/min时,离子源最大束流可达 100 mA (图 6),它的质子比达到了 85 %以上。



图 5 强流 ECR 离子源结构示意图 Fig. 5 Schematic diagram of ECR ion source

用"缝-板"法初步测量了源的发射度。离 子束穿过一排狭缝并漂移相当距离后,在一块 铝板上打出清晰的束斑印痕。据此作出的相图 示于图 7。它的实验室发射度值为 216 mm ·mrad,相应的归一化均方根发射度约为 mms=0.11 mm ·mrad。



Tig. / Emittance of the bet

3 离子源的可靠性试验

对于本工作所研制的离子源,欲保持长时 间稳定运行,首先必须解决高电压打火问题。 由于引出孔附近气压较高,又存在很强的电场 与磁场,很容易引起高压击穿打火。试验和排 除了各种因素后证实,在现在实验装置的条件 下,扩散泵油蒸气的污染是引起打火的重要原 因。油蒸气在放电室中形成碳膜,又会影响离 子源寿命。在增加了冷阱之后,打火现象大为 减少。

影响离子源寿命的另一主要因素是放电室 的微波窗损坏。引出区气体被轰击电离,产生 的电子受电场加速穿过引出孔返流打到放电室 底部的微波窗上,这些电子轰击的能量很大而 且集中,微波窗的散热条件又差,工作一段时间 后,微波窗即被烧蚀出孔或开裂。本工作设计 了一种独特的微波馈入方式,使反轰的电子束 不能打到窗板上,从而避免出现这一严重问题。

在上述基础上,对离子源作连续运行100h 的考验。这次运行,除在启动后的两小时内进 行高电压锻炼时因打火中断一次外,以后的 100h内未出现束流中断。在这100h中,束流 的可利用率几乎为100%。

4 结论与今后的工作

所研制的两种结构的离子源在加速电压为 30 kV 时,氢离子束流均超过了 50 mA,最大可 达 100 mA,质子比为 85 % ~ 92 %。初步测定 的均方根发射度约为 0.11 mm ·mrad,并通过 了 100 h 的运行考验。这些都达到了预定的指 标。为了将加速电压提高到 75 kV 以上,一台 新离子源和一台 100 kV、110 mA 的离压电源 即将投入试验。真空系统将改用分子泵抽气。 为了准确地测定束流发射度,一台强流发射度 测量仪正在调试中。为了保持束流的稳定,一 台稳定的磁控管电源也即将完成。进一步的试 验正在进行中。

丁大钊院士与关遐龄教授对本工作给予了

许多有益的指导,北京大学重离子物理研究所 研制了发射度仪,在此表示感谢。

参考文献:

- Wills JSC, Lewis RA, Diserens J, et al. A Conr pact High Current Microwave Driven Ion Source [J]. Rev Sci Instrum, 1998, 69(1):65~68.
- [2] Sherman J, Arvin A, Hansborough L, et al. Status Report on DC 130 mA, 75 keV Proton Injector
 [J]. Rev Sci Instrum, 1998, 69 (2): 1 003 ~ 1 008.
- [3] Hwang Y, Hong I, Kim H. Development of a High Current Microwave Ion Source for Korean Multipurposed Accelerator [J]. Rev Sci Instrum, 1998,69(2):1015~1020.
- [4] Celona L, Ciavola G, Gammino S. TRIPS: The High Intensity Proton Source for the TRASCO Project [J]. Rev Sci Instrum, 2000, 71 (2): 771 ~ 773.
- [5] Popov A. Effects of Magnetic Field and Microwave Power on Electron Cyclotron Resonance Type Plasma Characteristics [J]. J Vac Sci Technol, 1991, A9(3):711~716.

© 1994-2006 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net